

**NAR Labs**  
國家實驗研究院

# PIII注意事項

1. 申請表請務必詳實填寫。(如:佈植氣體、能量、劑量)
2. 植入能量勿低於1 keV或高於10 KeV。劑量勿低於5E14或高於1E16。
3. 非12"及8"晶圓，限定以真空膠帶粘妥於8吋晶圓上。
4. 樣品有大片金屬勿送件。
5. 非標準製程務必和機台負責工程師連絡討論可行性，欲送件前如有任何問題請與機台負責工程師連絡。
6. 本機台每2個月對AsH<sub>3</sub> (n型)及BF<sub>3</sub> (p型)佈植摻雜轉換一次，欲送件前請先確定機台佈植類型。